

装置開発室装置利用申請書（ナノプラットフォーム事業成果非公開）

年 月 日

分子科学研究所長 殿

所属 住所（〒 ）

職名 電話

ふりがな FAX

氏名 e-mail

企業種別(*)： 大企業 中小企業 その他 分野・業種等(*)：

*・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施に当たって、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負えることを誓約します。

記

1. 研究課題名：

2. 利用を希望する設備と利用期間

マイクロストラクチャー 3次元光学プロファイラー ZYGO NexView

製作・評価支援： マスクレス露光装置 NanoSystem Solutions DL-1000

(付属装置) スピンコーター MS-A100

マスクアライナー MA-10

利用期間： 年 月 日 ～ 年 月 日

利用日数及び時間数： 日間 (時間)

※利用期間は1か月以内とすること。

※利用日数及び時間数（見込み）については、最大の数字を記入すること。

3. 放射線業務に従事することの有無 有 無

(注) 有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。)

4. 研究の具体的方法

5. 希望事項

6. 研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合、氏名、所属及び職名

区分	氏名	所属	職名
申請者			
1			
2			
3			
4			
5			

同伴者は5名まで可能です。申請者のほかに共同利用研究者に含める同伴者を記入してください。

7. 不正防止に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。

(1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

(平成26年8月26日文部科学大臣決定)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf

(2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針
(平成20年2月28日決定)

<https://www.nins.jp/site/rule/1024.html>

(3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成20年2月28日自機規程第74号）

<https://www.nins.jp/uploaded/attachment/3157.pdf>

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

8. 安全管理に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (<https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf>) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

上記の装置利用の申込みを承認する。

所 属：

職 名：

氏 名：

上記は、申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを承認できる方の所属、職名及び氏名(申請者本人は不可)を記入の上、捺印ください。

記載
不要

ナノプラットフォーム事業 実施責任者	装置開発室長	担当者

【企業種別基準】

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの

中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの

その他 上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／25 その他